522-34

AU 151

DT 3415033 OCT 1944

4 24 10

A60 E14 G06 V04 (A89) 84-257886/42 HITACHI LTD (HITB)

HITA 21.04.83

*DE 3415-033-A 21.04.83-JP-070726 (11.10.84) C03c-01/70 C03f-C /26 C07c-117

C08f-02/48 C08f-116/36 C08f-126/02
New 4'-azido-benzal-2 --methoxy-acetophenone --

photo:cure of polymer in photographic, printing or electronics

C84-109012

Full Patentees: Hitachi Chemical Co.Ltd.;

Hitachi Ltd.

CLAIMED AS NEW

4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenone of formula (I)

$$N_3$$
 CH=CH-C O (i)

USE/ADVANTAGE

(I) is used as photosensitive compans, useful in the photographic, printing and electronics industries, causing photocure of polymers soluble in aq. alkaline solns. It is much more soluble than the corresp. 4-methoxy cpd.

A(8-C9, 8-D3, 12-E7, 12-L28, 12-W7C) E(10-A6) G(5-A, 6-D5, 6-D6. 6-F3D1 N(1-A1) 188

PRODUCTION

(i) is prepd. by reacting p-szidobenzaldehyde (II) with 2-methoxyacetopnenone (III), using an alkaline catalyst (e.g. NaOH or KOH).

The reaction can be carried out in a solvent (water or alcohols, e.g. MeOH and E:OH) in which the alkaline cpd. is soluble and the reaction temp. prei, is in the 0-40°C range.

PREFERRED COMPOSITION

The photosensitive compsn. contains (I) and a polymer. which is soluble in aq. alkaline soln, but becomes insul. as a result of photocure with (I).

The polymer contains OH and/or COOH gps. and has an

Mn of 500 or more.

Suitable polymers include novolak and polyhydroxystyrene resins and (meth)acrylic (co)polymers. (I) is used in an amt. of 5-100 wt. % w.r.t. the polymer.

The compsn. may also contain an organic solvent.

EXAMPLE

A mixt. of 15g. (III) (99% pure), 15g. (II), 50g. 10% ac. NaOH soln, and 50g. MeOH was stirred for 24 h under

© 1984 DERWENT PUBLICATIONS LTD. 128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101 Unauthorised copying of this abstract not permitted.

yellow light at 25°C. The crystals formed were filtered, washed with water, dried and recrystallised from EtOH. The (I) obtd. was 99% pure and practically free from isomers with the methoxy substit. in other positions.

(I) was obtd. in the form of yellow crystals with a max. absorption in the UV spectrum at 330 nm (in EtOH) and minpt. of 90°C.

The relative solubility at 15°C of (A) (I), (B) the 4-methoxy or (C) the 3-methoxy isomer in cyclohexanone was (A) 3, (B) 1, (C) 0.5° in 'Ethylcellosolve acetate' (RTM) (A) 2.6, (B) i, (C) 0.04°; and in isoamyi acetate (A) 2.8, (B) 1, (C) 0.3.(20pp016WADwgNo0/0).

© 1984 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101

Unauthorised copying of this abstract not permitted.

(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offenlegungsschrift





DEUTSCHES PATENTAMT (21) Aktenzeichen: Anmeldetag:

P 34 15 033.1 19. 4.84

11. 10. 84 Offenlegungstag:

(51) Int. Cl. 3: C07 C 117/00

> C 08 F 2/48 C 08 F 116/36 C 08 F 126/02 G 03 C 1/70 G 03 F 7/26

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

- (3) Unionspriorität: (3) (3)

20.04.83 JP P69450-83

21.04.83 JP P70726-83

(7) Anmelder:

Hitachi Chemical Co., Ltd.; Hitachi, Ltd., Tokio/Tokyo, JP

(74) Vertreter:

Kraus, W., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Weisert, A., Dipl.-Ing. Dr.-Ing.; Spies, J., Dipl.-Phys., Pat., Anw., 8000 München

@ Erfinder:

٠٠٠٠

Koibuchi, Shigeru; Isobe, Asao, Hitachi, JP; Makino, Daisuke, Mito, JP

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(4) 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon, Verfahren zu seiner Herstellung und es enthaltende, photoempfindliche Masse

Es wird 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon beschrieben, das eine sehr gute, photoempfindliche Verbindung ist und eine photoempfindliche Masse zusammen mit einem in wäßriger, alkalischer Lösung löslichen Polymeren, das in der wäßrigen, alkalischen Lösung durch photochemische Härtung mit 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon insolubilisiert werden kann, und gegebenenfalls zusammen mit einem organischen Lösungsmittel ergibt. Diese Masse zeigt eine sehr geringe Viskositätsänderung im Verlauf der Zeit.

KRAUS WEISERT & PARTNER

(45°)

1.0

PATENTANWÄLTE

UND ZUGELASSENE VERTRETER VOR DEM EUROPÄISCHEN PATENTAMT

DR. WALTER KRAUS DIPLOMCHEMIKER - DR.-ING. DIPL.-ING. ANNEKÄTE WEISERT - DIPL.-PHYS. JOHANNES SPIES

IRMGARDSTRASSE 15 - D - 8000 MUNCHEN 71 - TELEFON 089/797077

TELEGRAMM KRAUSPATENT - TELEX 5-212156 kpatd - TELEFAX (089) 7918233

4426 AW/My

HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD., Tokyo, Japan und HITACHI, LTD., Tokyo, Japan

THE CHARGE TO

4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon, Verfahren zu seiner Herstellung und es enthaltende, photoempfindliche Masse

S. 12.

Patentansprüche

(1.) 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon der Formel

2. Verfahren zur Herstellung von 4'-Azidobenzal-2methoxyacetophenon der Formel

dadurch gekennzeichnet, daß man p-Azidobenzaldehyd mit

2-Methoxyacetophenon unter Verwendung einer alkalischen
Verbindung als Katalysator umsetzt.

2-1

3. Photoempfindliche Masse, dadurch gekennzeichnet, daß sie

2 71:

(a) 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon der Formel

und

₹ :

5

15

20

(b) ein in wäßriger, alkalischer Lösung lösliches Polymeres, welches durch photochemisches Härten mit
der Komponente (a) in wäßriger, alkalischer Lösung unlöslich gemacht werden kann,
umfaßt.

4. Masse nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß das in wäßriger, alkalischer Lösung lösliche Polymere ein Polymeres mit Hydroxylgruppen und/oder Carboxylgruppen und einem zahlendurchschnittlichen Molekulargewicht von 500 oder mehr ist.

310

3

- 1 5. Masse nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das in wäßriger, alkalischer Lösung lösliche Polymere ein Novolakharz, ein Polyhydroxystyrolharz, ein acrylisches Polymeres oder Copolymeres oder ein methacrylisches Polymeres oder Copolymeres ist.
 - 6. Masse nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil der Komponente (a) 5 bis 100 Gew.%, bezogen auf das Gewicht der Komponente (b), beträgt.
- 7. Masse nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß sie zusätzlich ein organisches Lösungsmittel enthält.

15 ಕರ್ಷ ಇದರ ಮಹಾರ ಸ್ಥಾಪ ಅರವಿಶ್ವದ ಚರ್ಸ್ ಅನಿ ಪ್ರಾಕರ್ಮದಲ್ಲಿ

20

10

lact described to the substitute of the second of the seco

25

)4 I U U U U

4

Die Erfindung betrifft 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon, ein Verfahren zu seiner Herstellung und eine
photoempfindliche Masse, die es enthält und die in der
photographischen Industrie, der Druckindustrie, der elektronischen Industrie, usw. verwendet werden kann. In der
vorliegenden Erfindung wird der Ausdruck "Masse" synonym mit "Zusammensetzung" oder "Mittel" verwendet.

Es ist bekannt, daß Azidverbindungen als photoempfindli-10 che Materialien verwendet werden können und daß als filmbildende Polymer Polymere, die in alkalischer Lösung löslich sind, eingesetzt werden können. Derartige Verbindungen werden in den JA-OSen 22082/70, 26048/69, 34902/ 78 und 4481/74 beschrieben. Werden photoempfindliche Massen bei verschiedenen Zwecken in der photographischen Industrie, der Druck- oder Elektronik- und anderen Industrien verwendet, ist es erwinscht, daß die in den Massen verwendeten Azidverbindungen in dem zu verwendenden Lösungsmittel sehr löslich sind. Damit die Azidver-20 bindungen in den Lösungsmitteln besser löslich sind, hat man verschiedene Verfahren angewandt. Beispielsweise wird eine photoempfindliche Masse, die 4'-Azidobenzal-4-methoxyacetophenon und ein Alkali-lösliches Polymeres enthält, in der obigen JA-OS 34902/78 beschrieben. Jedoch kann 4'-Azidobenzal-4-methoxyacetophenon nicht als ausreichend löslich in Lösungsmitteln angesehen werden, vermutlich wegen der als Substituent in der 4-Stellung

Andererseits gibt es hinsichtlich der Qualität für photoempfindliche Massen auf dem Gebiet der Präzisionsinstrumente, wie auf elektronischem Gebiet, sehr strenge Vorschriften. Beispielsweise muß das Problem, daß sich die Viskosität der Masse im Verlauf der Zeit ändert, gelöst

vorhandenen Methoxygruppe.

35 werden, da Viskositätsänderungen bei der Erzeugern von Halbleitern oder dergl.Schwierigkeiten ergeben.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine: Azidverbindung zur Verfügung zu stellen, die in einem Lösungsmittel sehr gut löslich ist und die als photoempfindliche Verbindung des Negativ-Typs wirkt

5 und zusammen mit einem photoempfindlichen Polymeren eine Masse ergibt, welche im Verlauf der Zeit nur eine sehr geringe Viskositätsänderung erleidet. Erfindungsgemäß soll weiterhin ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Verbindung zur Verfügung gestellt werden.

Erfindungsgemäß soll eine photoempfindliche Masse zur Verfügung gestellt werden, welche eine photoempfindliche Verbindung enthält, die eine sehr verbesserte Löslichkeit in einem Lösungsmittel aufweist, und die ein Polymeres enthält, welches in

15 wäßriger, alkalischer Lösung löslich ist, aber in der alkalischen, wäßrigen Lösung durch photochemische Härtung mit der photoempfindlichen Verbindung insolubilisiert mebzw: unlöslich gemacht werden kann, wobei die photorempfindliche Masse insbesondere im Verlauf der Zeit eine

20 = wesentliche Verbesserung bei sihrer Viskositätsänderung STRIP TO CA besitzen soll.

Gegenstand der Erfindung ist 4'-Azidobenzal-2-methoxy-

acetophenon der Formel

$$N_3 - CH = CH - C - CH_3$$
(I)

30 und ein Verfahren zu seiner Herstellung.

Gegenstand der Erfindung ist weiterhin eine photoempfindliche Masse, welche

35

25

6

(a) 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon der

Formel

1

5

25

30

35

$$N_3 - O - CH = CH - C - O$$

$$O CH_3$$

$$O CH_3$$

$$O CH_3$$

und

(b) ein in wäßriger, alkalischer Lösung lösliches Polymeres enthält, welches in der wäßrigen, alkalischen Lösung durch photochemische Härtung mit der Komponente (a) insolubilisiert werden kann.

In den beigefügten Zeichnungen wird die Erfindung näher erläutert; es zeigen:

Fig. 1 die molekularen Ionenpeaks in einem Massenspektrum der erfindungsgemäßen Azidverbindung;

Fig. 2 und 3 IR - und MR-Spektren für die erfindungsgemäße Äzidverbindung; hind - 14226 - 14624

4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon kann durch Umsetzung von p-Azidobenzaldehyd mit 2-Methoxyacetophenon in Anwesenheit einer alkalischen Verbindung als Katalysator hergestellt werden. Bevorzugt werden diese Reaktionsteilnehmer in fast äquimolaren Mengen verwendet. Geeignete, alkalische Verbindungen für den Katalysator sind die Hydroxide von Alkalimetallen, z.B. Natriumhydroxid, Kalliumhydroxid, usw.

Die obige Reaktion erfolgt in einem Lösungsmittel, das die alkalische Verbindung lösen kann. Beispiele von Lösungsmitteln sind Wasser und Alkohole, wie Methanol und Ethanol. Die Reaktionstemperatur liegt bevorzugt, obgleich sie nicht besonders beschränkt ist, im Bereich 7 -:

von O bis 40°C wegen der Stabilität des Produktes und der Reaktionsgeschwindigkeit.

Weiterhin wird die Synthese bevorzugt in gelbem Licht durchgeführt, da 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon der Formel (I) eine photoempfindliche Verbindung ist.

Das so hergestellte 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon kann zur Herstellung einer photoempfindlichen Masse zusammen mit einem in einer wäßrigen, alkalischen Lösung löslichen Polymeren, das in einer wäßrigen, alkalischen Lösung durch photochemische Härtung mit dieser Azidverbindung insolubilisiert wird, einem Lösungsmittel und ähnlichen Zusatzstoffen verwendet werden.

Das in der wäßrigen, alkalischen Lösung lösliche Polymere ist ein Hochpolymeres mit Hydroxylgruppen und/oder Carboxylgruppen. Beispiele hierfür sind Novolakharze Polyhydroxystyrolharze, Acryl- und Methacrylpolymere. Diese können in Form von Homo-oder Co-Kondensaten oder Homo-oppolymerisaten oder Copolymerisaten verwendet werden.

Diese können weiterhin allein oder als Gemische von ihnen verwendet werden.

Diese Harze sind im Handel erhältlich. Beispielsweise sind Beispiele für Novolakharze Phenolnovolakharz, Cresolnovolakharz, Phenol-Cresolnovolakharz, usw.; Beispiele für Polyhydroxystyrolharze sind Poly-(p-vinyl-phenol) und bromiertes Poly-(p-vinylphenol), usw.;

Acryl- oder Methacrylpolymere sind z.B.ein Homopolymeres von Acrylsäure oder Methacrylsäure, Copolymere von Acrylsäure oder Methacrylsäure mit Acrylsäureestern oder Methacrylsäureestern und Copolymere von Acrylsäure oder Methacrylsäure mit Styrol.

8

Das in einer wäßrigen, alkalischen Lösung lösliche Polymere sollte einen Film nach Entfernung des Lösungsmittels bilden und daher ein zahlendurchschnittliches Molekulargewicht von vorzugsweise mindestens 500 und bevorzugter von 1000 oder mehr wegen der Wärmebeständigkeit der entstehenden, photoempfindlichen Masse aufweisen.

Dieses in wäßriger, alkalischer Lösung lösliche Polymere wird in einer alkalischen, wäßrigen Lösung durch photochemisches Härten, das gemäß einem an sich bekannten Verfahren unter Verwendung einer Quecksilberlampe oder einer ähnlichen Lichtquelle durchgeführt werden kann, insolubilisiert. Durch dieses Härten wird das in wäßriger, alkalischer Lösung lösliche Polymere darin unlöslich und somit damit entwickelbar.

Die Entwicklung erfolgt unter Verwendung beispielsweise einer wäßrigen Lösung von Natriumhydroxid, Kaifumhydroxid oder Tetramethylammoniumhydroxid in einer Konzentration von bis zu 5 Gew. %.

Die erfindungsgemäße, photoempfindliche Masse kann weiterhin ein organisches Lösungsmittel enthalten. Die photoempfindliche Masse kann auf die Oberfläche eines Sübstrats, welches beispielsweise aus Silicium, Aluminium
oder einem ähnlichen Material hergestellt worden ist, in
Form einer in einem organischen Lösungsmittel gelösten
Lösung aufgetragen werden. Als organisches Lösungsmittel
kann man Ketone, z.B. Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon, Cyclohexanon, etc.; Cellosolve, z.B. Methylcellosolve, Methylcellosolveacetat, Ethylcellosolveacetat, etc.; sowie Ester, z.B. Ethylacetat, Butylacetat,
Isoamylacetat, usw., verwenden. Diese Lösungsmittel können allein oder als Gemisch eingesetzt werden.

1 Ein geeignetes Mischverhältnis von (a) 4'-Azidobenzal-2methoxyacetophenon zu (b) dem in wäßriger, alkalischer Lösung löslichen Polymeren beträgt bevorzugt 5:100 bis 100:100 und mehr bevorzugt 10:100 bis 50:100 (ausgedrückt durch das Gewicht). Der Gehalt an organischem Lösungsmittel in der photoempfindlichen Masse beträgt be-

vorzugt 100 bis 2000 Gew.Teile/100 Gew.Teile der Komponenten (a) und (b)

" กราไซเก็ก

Train do trib Wenn eine photoempfindliche Masse, die eine bekannte, photoempfindliche Verbindung, z.B.-4!-Azidobenzal-3methoxyacetophenon oder 4'-Azidobenzal-4-methoxyacetophenon, und das in wäßriger, alkalischer Lösung lösliche Polymere enthält, sin Lösung bei 2000 stehengelassen wird, findet eine allmähliche Erhöhung; insder Viskosität nach etwa 3 Monaten und eine Erhöhung von 10% oder mehr in der Viskositätynach 6 Monaten oderslänger statt. Obgleich die genauen erlaubten Werte fürgdie Erhöhung "cder Viskosität nicht klar sind ekilter sageringer die Erhöhung in der Viskosität ist, umso besser ist es Die erfindungsgemäße, photoempfindliche Masse zeigt eine

wesentlich kleinere Anderung in den Viskosität im Verlauf der Zeit, verglichen mit bekannten Massen, die die oben erwähnte, photoempfindliche Verbindung und ein in wäßriger, alkalischer Lösung lösliches Polymeres ent-

halten.

Die erfindungsgemäße, photoempfindliche Masse kann weiterhin eine oder mehrere bekannte Hilfskomponenten in Abhängigkeit von ihrem Anwendungszweck enthalten. Solche 30 zusätzlichen Hilfskomponenten sind beispielsweise ein thermischer Polymerisationsinhibitor für die Sicherstellung der Lagerungsstabilität, ein Inhibitor zur Verhinderung der Lichthofbildung, bedingt durch die Lichtreflexion von dem Substrat, ein Verbesserer für die Ad-35



häsion, um die Adhäsion an das Substrat zu verbessern, etc.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung. In den Beispielen sind alle Teile und Prozentgehalt, sofern nicht anders angegeben, durch das Gewicht ausgedrückt.

Beispiel 1

11 202 and -

25

35

In einen 500-ml-Kolben gibt man 15 g 2-Methoxyacetophenon (hergestellt von Aldrich Co.; 99%ige Reinheit),
15 g p-Azidobenzaldehyd (hergestellt von Kanto Chemical
Co., Ltd.), 50 g 10%ige wäßrige NaOH-Lösung und 50 g
Methanol. Die Mischung wird 24 h unter Gelblicht bei
25°C gerührt. Nach Beendigung der Umsetzung werden die
abgeschiedenen Kristalle filtriert, mit Wasser gewaschen,
getrocknet und aus Ethanol umkristallisiert.

Das verwendete 24Methoxyacetophenon besitzt eine Reinheit von 99% und enthält praktische keine Isomeren, die sich in der Stellung des Methoxy-Substituenten unterscheiden. Es ist sicher, daß die Stellung des Methoxy-Substituenten ten in dem 2-Methoxyacetophenon während der Synthese in der wäßrigen, alkalischen Lösung sich nicht ändert.

Das so erhaltene 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon wird durch die folgenden Analysen identifiziert.

- (A) Massenspektrometrie (200°C, 50 eV), m/e = 279.

 In Fig. 1 ist ein Beispiel des Spektrums dargestellt.
 - (B) IR-Spektrometrie (KBr-Verfahren)
 In Fig. 2 ist ein Beispiel des Spektrums dargestellt. Eine starke Absorption, bedingt durch die Azidogruppe (-N3), wird bei 2100 cm⁻¹ festgestellt.

11

1 (C) NMR-Spektrometrie (¹H-NMR)
Fig. 3 zeigt ein Beispiel des Spektrums. Zusätzlich
sind die Spektren der 3-Methoxy- und 4-Methoxy-Isomeren
in Fig. 4 bzw. 5 dargestellt.

Aus Fig. 3 werden -OCH₃ und o identifiziert, d.h.

die Anwesenheit der 2-Methoxygruppe wird durch Vergleich der Fig. 3 mit den Fig. 4 und 5, die Vergleichsbeispiele zeigen, sichergestellt. Das Spektrum zwischen 6,8 ppm und 8,1 ppm unterscheidet sich in Abhängigkeit von der Stellung des Methoxy-Substituenten.

(D) Kristallfarbe: gelb

....

- (E) Maximale Absorption in dem UV-Spektrum: 330 nm (in Ethanol)
 - (F) Schmelzpunkt: 90°C.

Die Löslichkeit bei 15°C des in Beispiel 1 synthetisierten 4!-Azidobenzal-2-methoxyacetophenons wird derjenigen der Isomeren verglichen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

	Photoempfindliche	<u>Tabello</u> Lösli CH	<u>e 1</u> chkeit bei 15 ⁰ 0 ECA	in IA
25	Verbindung 4'-Azidobenzal-2-meth- oxyacetophenon	3	2,8	2,8
	4'-Azidobenzal-4-meth- oxyacetophenon	1	1	1
30	4'-Azidobenzal-3-meth- oxyacetophenon	0,5	0,04	0,3

CH = Cyclohexanon

ECA = Ethylcellosolve-acetat

IA = Isoamylacetat



12

- Die in Tabelle 1 dargestellten Löslichkeiten sind relative Werte, wenn die Löslichkeit von 4-Azidobenzal-4-methoxyacetophenon als 1 definiert wird.
- Eine photoempfindliche Masse wird durch Auflösen von
 1 Teil 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon, synthetisiert in Beispiel 1, und 5 Teilen Poly-(p-vinylphenol)
 (hergestellt von Maruzen Oil Co., Ltd.) in 25 Teilen
 Cyclohexanon hergestellt. Die Masse wird 30 sec bei
 3000 U/min auf einer Aluminiumplatte durch Spinnen aufgetragen und unter Bildung eines photoempfindlichen
 Überzugs mit einer Dicke von etwa 1 um getrocknet.
- Das so beschichtete Substrat wird 10 sec Licht mit einer Intensität von 10 mW/cm² (bestimmt auf einem Strahl mit einer Wellenlänge von 365 nm) unter Verwendung einer 250 W Quecksilberlampe unterworfen. Der belichtete Überzug wird in eine 1%ige wäßrige Tetramethylammonium hydroxid-Lösung 5 min bei 20°C eingetaucht, aber der
- 20 hydroxid-Lösung 5 min bel 20 C eingetaucht, aber der Uberzug löst sich nicht. Falls er dem Licht nicht ausgesetzt ist, löst sich der gleiche photoempfindliche Überzug innerhalb 1 bis 2 sec in der oben erwähnten Entwicklungslösung. Somit konnte bewiesen werden, daß die er-
- haltene Masse als photoempfindliche Masse gut geeignet ist.

Beispiel 3

Eine photoempfindliche Masse wird durch Auflösen von

1 Teil des in Beispiel 1 hergestellten 4'-Azidobenzal2-methoxyacetophenons und 4 Teilen eines Cresolnovolakharzes (PSF-2807, Handelsbezeichnung; hergestellt von
Gun-ei Kagaku K.K.) in 25 Teilen Ethylcellosolveacetat
hergestellt. Die Masse wird 30 sec bei 3000 U/min durch
Spinnen auf ein Silikonplättchen aufgetragen und unter



Bildung eines 1 um dicken, photoempfindlichen Überzugsgetrocknet.

Der photoempfindliche Überzug wird 3 sec mit Licht durch eine Chrommaske unter Verwendung der gleichen Quecksilberlampe, wie sie in Beispiel 2 verwendet wurde, belichtet. Der Überzug wird dann mit einer 2%igen wäßrigen Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung zur Auflösung und Entfernung der nichtbelichteten Teile des Überzugs behandelt, und man erhält so ein Muster aus parallelen Linien mit jeweils einer Breite von 2 um und einem Abstand von 2 um.

Beispiel 4

- Eine photoempfindliche Masse wird durch Auflösen von 1 Teil des in Beispiel 1 synthetisierten 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenons und 4 Teilen eines 3:7 (molares Verhältnis) Methacrylsäure-Butylmethacrylat-Copolymeren in 40 Teilen Methylcellosolveacetat hergestellt.
- Die Masse wird 30 sec bei 3000 U/min durch Spinnbeschichten auf ein Silikonplättchen aufgetragen und unter Bildung eines 1,5 um dicken, photoempfindlichen Überzugs getrocknet.
- Der photoempfindliche Überzug wird 5 sec Licht durch eine Chrommaske unter Verwendung der in Beispiel 2 eingesetzten Quecksilberlampe belichtet. Der Überzug wird dann mit einer 2%igen wäßrigen Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung zur Auflösung und Entfernung nichtbelichteter Teile des Überzugs behandelt. Man erhält so ein Muster aus parallelen Linien mit jeweils einer Breite von 1,5 /um und einem Abstand von 1,5 /um.



1 Vergleichsbeispiel 1

5

Zum Vergleich werden die Viskositätsänderungen im Verlauf der Zeit für die photoempfindliche Masse von Beispiel 2 und für jene bestimmt, die hergestellt werden, indem man das Verfahren von Beispiel 2 wiederholt, jedoch jeweils zwei Isomere, die sich in der Methoxy-Stellung unterscheiden, anstelle des 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenons verwendet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Photoempfindliche Verbindung Viskositätsänderung nach einmonatiger Lagerung bei 40°C (%)

4'-Azidobenzal-2methoxyacetophenon

4'-Azidobenzal-3-:
methoxyacetophenon

4'-Azidobenzal-4methoxyacetophenon

10

Bedingungen für die Messung der Viskositätsänderung:

Jede Probe wird 1 Monat bei 40°C in einem Behälter gelagert, der aus einem Material besteht, welches Strahlen
mit einer Wellenlänge von 500nm oder weniger schneiden
kann. Die gefundene Viskositätsänderung wurde mit der
einer Probe verglichen, die 1 Monat bei 20°C in dem gleichen Behälter, wie oben, gelagert wurde.

Aus den Tabellen 1 und 2 geht hervor, daß das erfindungsgemäße 4'-Azidobenzal-2-methoxyacetophenon in organischen
Lösungsmitteln löslicher ist als bekannte Azidverbindungen des Negativ-Typs und eine photoempfindliche Masse ergibt, die die halbe oder weniger Viskositätsänderung
im Verlauf der Zeit aufweist als die aus den bekannten
Azidverbindungen hergestellten, photoempfindlichen Massen.

30

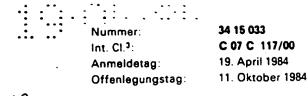
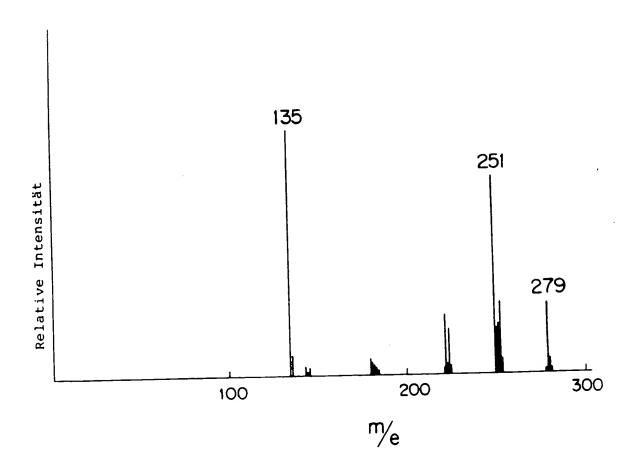
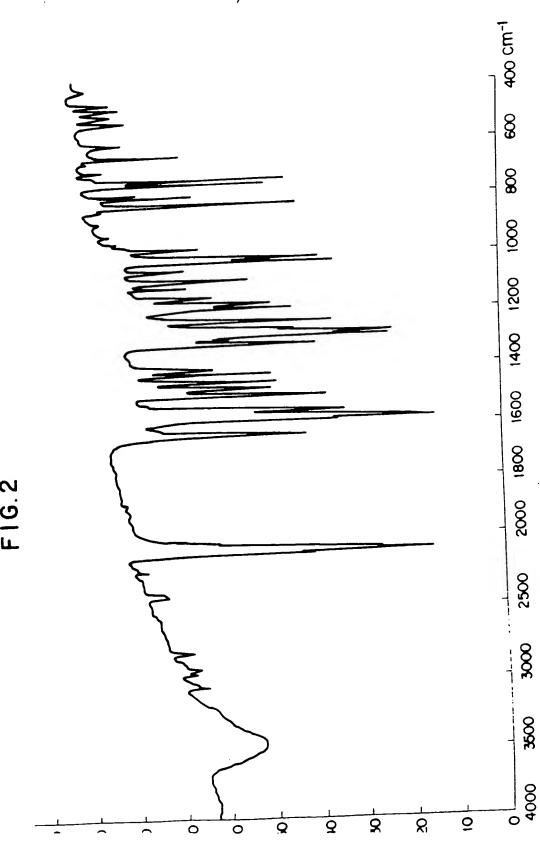


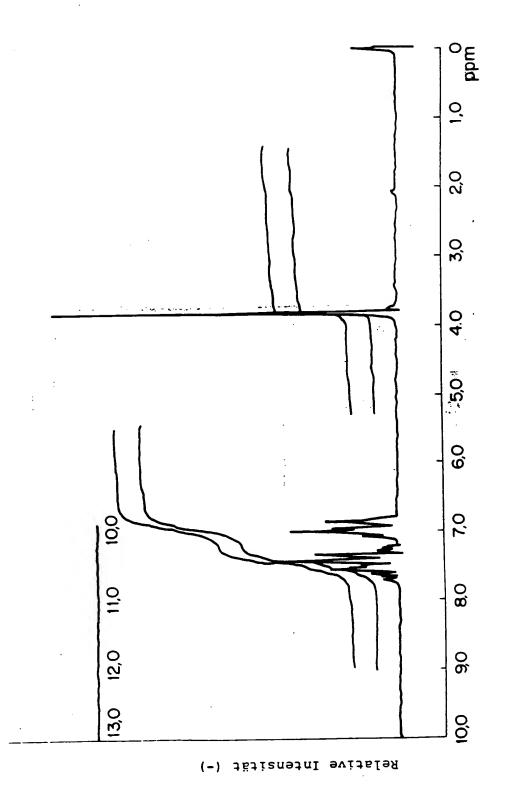
FIG. 1



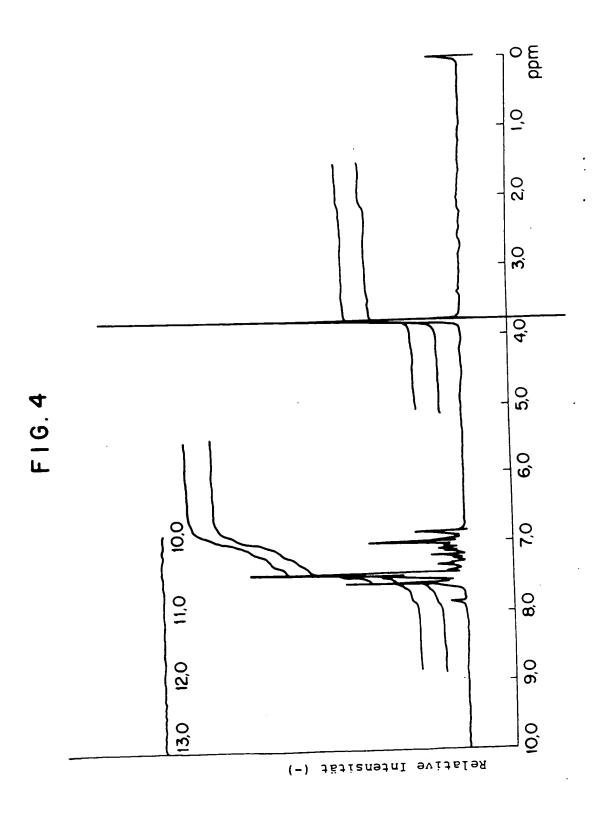




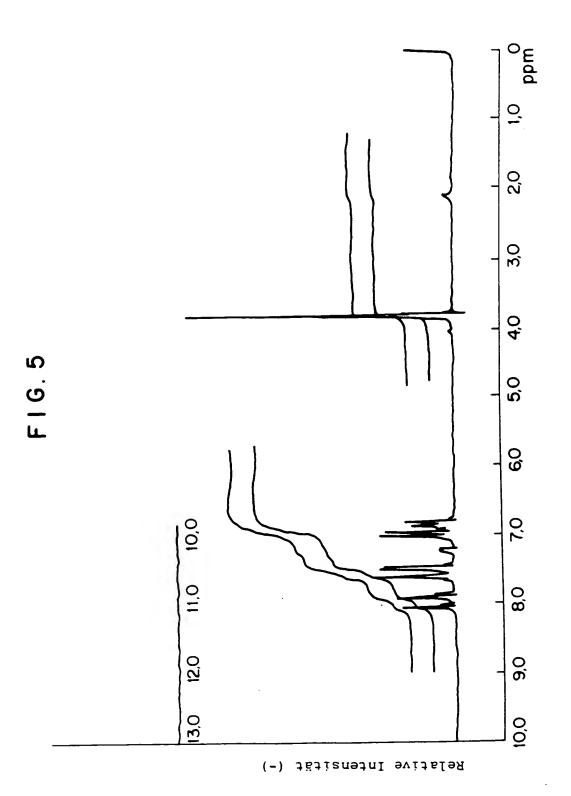
- 16 .



.17.



- 18.



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.